

(公印省略)

LSI第19号  
令和7年6月5日

大分県LSIクラスター形成推進会議  
会員の皆様へ

大分県LSIクラスター形成推進会議  
会長 川越 洋規

令和7年度大分県LSIクラスター形成推進会議 総会／フォーラムの開催について(ご案内)

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素より、大分県における半導体産業の振興に多大なるご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

当推進会議では、産学官が連携し、地場企業と進出企業の共生・発展を図る「大分県LSIクラスター構想」のもと、半導体関連産業の振興に向けた取組みを着実に推進しております。特に近年では、研究開発、人材育成、販路開拓、会員交流の4本柱に基づいた中期ビジョン(令和4～6年度)のもと、「未来を拓く 産業モデルの創出 ～想いをカタチに 共感で広げる～」をスローガンに、持続可能で競争力のある地域産業の実現に向けた活動を強化してまいりました。

このたび、産学官のネットワークをさらに広げ、半導体関連産業の更なる発展に資することを目的として、令和7年度の総会／フォーラムを下記のとおり開催することと致しました。

総会では、当会議のこれまでの活動報告と今後の方針についてご説明いたします。

フォーラムでは、キオクシア株式会社 取締役 副社長執行役員 渡辺 友治 氏を基調講演にお迎えし、同社の先進的な取組みや業界展望についてお話しいただく予定です。加えて、昨年度に引き続き、インフォマインテリジェンス合同会社 シニアコンサルティングディレクター 南川 明 氏による特別講演も予定しており、最新の半導体市場動向について貴重なご知見を共有頂けるものと存じます。

本総会／フォーラムでは、当推進会議の会員はもとより会員以外の企業の参加も募っており、終了後は交流会(参加料:4,000円)も予定しておりますので、情報交換、ネットワーク拡大の好機として、是非とも積極的にご参加くださいますようお願い申し上げます。

■申込方法:下記URLまたは二次元コードからアクセスの上、6月30日(月)までに登録をお願い致します。

令和7年度大分県 LSI クラスター形成推進会議 総会／フォーラム 参加申込

<https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/R7LSI-sanka>



## 記

1. 開催日時 令和7年7月14日(月)14:00～19:30
2. 開催場所 レンブラントホテル大分 2階 二豊の間  
〒870-0816 大分市田室町 9-20 (TEL:097-545-1040)
3. 開催内容 別添プログラムのとおり
4. 主催 大分県、大分県LSIクラスター形成推進会議
5. 連絡先 大分県LSIクラスター形成推進会議事務局(担当:矢野/檜原)  
〒870-1117 大分市高江西 1-4361-10  
TEL/FAX:097-596-7179  
E-mail: oita-lsi@columbus.or.jp